

## 半導体製造プロセス用高純度化学薬品および酸素ガスのろ過

“エンフロンPF”フィルターカートリッジは、すべてフッ素樹脂で構成されており、耐熱性・耐薬品性に優れています。この特性から、半導体製造プロセスで使用されているエッチング液や高純度化学薬品のろ過、さらに酸素ガスのろ過に適したフィルターです。また、小型の“エンフロンPF”は、フォトレジストの最終ろ過に適しています。

### 特長

- オールフッ素樹脂製フィルター (PTFE/PFA/FEP)
- プリーツ構造
- 6種類の定格ろ過精度：  
0.05、0.1、0.2、1、5、10 $\mu$ m (2230、4463タイプを除く)
- 全品出荷前完全性試験済

### 利点

- 幅広い耐薬品性を有し、ほとんどの高純度化学薬品のろ過に使用可能
- 溶着箇所が少なく、信頼性の高いろ過が可能
- 安価なイニシャルコスト
- 粗ろ過から最終ろ過システムまでに対応



### 材質

構成部品	材質
フィルターメディア	PTFE
コア、ケージ	PFA
エンドキャップ	PFA
メディアサポート	FEP溶着PTFE
O-リング材質	FEPカプセル・フッ素ゴム、FEPカプセル・シリコン、FFKM

### 仕様

形状	AB1タイプ	AB04タイプ	4463タイプ	2230タイプ
最高使用温度	185 °C			
ろ過精度 ( $\mu$ m) (液体)	0.05	0.05	—	—
	0.1	0.1	0.1	0.1
	0.2	0.2	0.2	0.2
	1	1	—	—
	5	5	—	—
	10	10	—	—
耐差圧	50 °C : 0.69 MPa 150 °C~110 °C : 0.41 MPa		110 °C~170 °C : 0.24 MPa 170 °C~185 °C : 0.14 MPa	

## 製品型式 AB ① ② 3E ③ ④

①

コード	カートリッジサイズ
1	10インチ
04	4インチ

②

コード	ろ過精度 (μm)
F005	0.05
F001	0.1
F002	0.2
F010	1
F050	5
F100	10

③

コード	O-リング材質
H1	FEPカプセル・フッ素ゴム
H15	FEPカプセル・シリコン
H38	FFKM

④

コード	オプション
-K3	プレウエット処理品
ナシ	プレウエット未処理品

## 製品型式 MPF ⑤ ⑥ E ③ ④

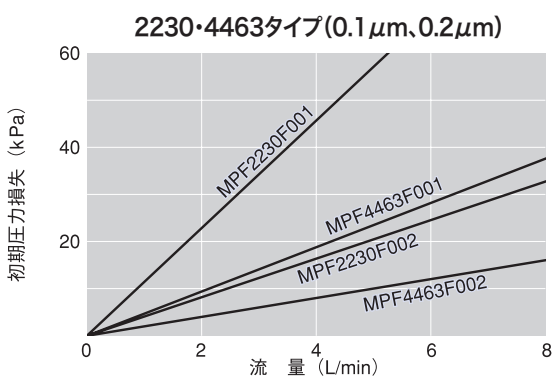
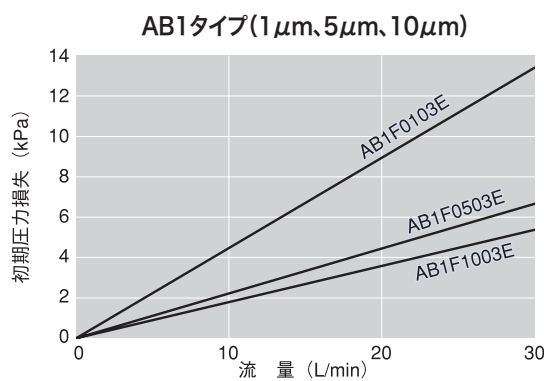
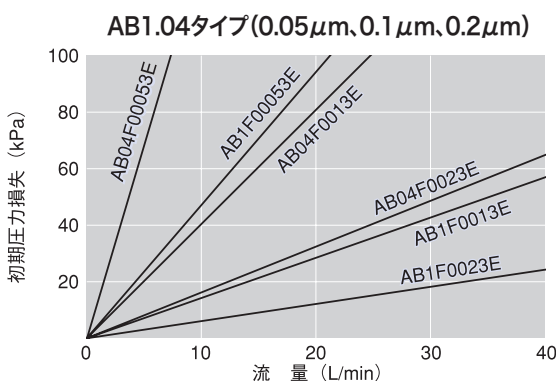
⑤

コード	ろ過面積
2230	0.07 m <sup>2</sup>
4463	0.17 m <sup>2</sup>

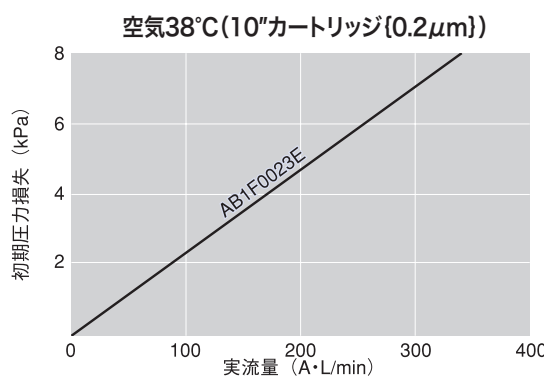
⑥

コード	ろ過精度 (μm)
F001	0.1
F002	0.2

## 流量－圧力損失特性 (水、20°C)



## 気体実流量－圧力損失特性



## 流体適合性

ほとんどすべての流体に適合します。ただし、流体および使用条件によってはご使用になれない場合があります。また、長期使用により部材は劣化します。定期的な交換をおすすめします。ご不明な点につきましては、当社各営業所までお問い合わせください。



〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1  
マイクロエレクトロニクス事業部 TEL.03(6901)5700

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性については保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。